

EV GROUP Advances Leadership in Optical Lithography With Next-generation EVG150 Resist Processing Platform – November 10, 2022



■提合暨微影技術設備領導廠資EV Group(EVG),今天宣布發表次世代200毫米版 本的EVG[®]150自動化光阻製程系統,強化該公司的光學微影解決方案產品組合。重新 設計的EVG150平台包括先進功能與強化項目。與前一代平台相比可提供更高的製程產 出(最多高出80%),通用性,以及更小的設備佔地面積(減少近50%)。EVG150在 通用的平台上提供可靠且高品質的途佈與顯影製程,可支援各種装置與應用,包括先進 封裝、微機電系統、無線射頻(RF)、3D感測、功率元件以及光子元件。EVG150種 高的製程產出、彈性與再現性,能支援大規模量產與工業開發所需的最屬前需求。 電子控制系統(EBS)產業的資尖研究中心Silicon Austria Labs是第一個採用実世 代EVG150系統的客戶。Silicon Austria Labs改系統研究部門負責人Mohssen Moridi 博士表示: 『早在工業4.0~物聯網。自動駕駛、虛實整合系統(CPS)、人工智慧、 智慧城市、智慧能源與智慧醫療問市前。我們就透過與引領樂界的製造商共同研究。開 發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG的次世代EVG150光唱製程系統的高度彈性。 為我們客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎。並推動EBS的創新。」

通用平台提供前所未見的彈性

為200毫米基板設計的次世代EVG150保育前一代平台引领業界的功能,包括具有 全自動化功能的可害製化的旋轉與噴霧式塗佈、顯影,烘烤與冷卻模組;EVG專有的O mniSpray[®]技術,可因應極端形貌的成形塗佈;精密且經現場驗證的機械化處理,員 雙末端執行器可確保持續的高製程產出;以及晶單遺錄,弓形,翹曲及薄化晶面的處 理,

次世代EVG150 200毫米平台的全新功能包括:

最多達四個灌式製程模組的空間,以及高速20個供烤/冷卻罩元,可以同時處理更多的 晶蓋。

獨立的光祖塗佈腔體便模組間完全隔離,幾乎完全消除模組間的交互污染, 模組經過進一步重新設計,可從設備外部更容易處理僅別的腔體,獲得最小的停機時 間,且在進行腔體保養時也可持續操作設備。 系統內部的腔體經重新定義,以便更容易以機械化處理來進行保養。

CONTRACTOR AND ADDRESS AND ADDRESS ADDRES

具有影像功能的預對準系統,可以隨時進行晶囊置中進而加速製程。

整合未統內部的光阻與化學藥液管線,可以減少儲存化學藥液的外部機穩空間,並降低 設備的佔地面積。

將使用者介面整合於系統內,可以進一步降低設備的佔地面積,

EV Group企業技術總整Thomas Glinsner博士表示: 「光唱製程與圖形化是半導 體製造中反覆進行最多次的製程步驟。EVG已經針對這些製程累積了多年的經驗。包括 光學做影、旋轉與續職式塗伤,以滿足最輩苛的客戶需求。我們將這些經驗融入到次世 代的EVG150系統中,這套系統經全面性的重新設計,可在適用平台上提供突破性的製 程產出與擁有成本效益,提供無與倫比的彈性,以滿足最廣泛的光唱製程需求。」

產品供應時程

EVG已經開始接受各界對次世代EVG150目動化光阻製程系統的訂單,並在公司總 部提供產品展示,更多相關資訊講蜜覽:https://www.evgroup.com/products/lithog raphy/resist-processing-systems/evg150/。

關於EV Group (EVG)

EVG是全球半導體、做機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶質製程 解決方素領導廠商,主要產品包括晶質鍵合、晶質循化、微影/奈米壓印微影技術(NI L)和檢測設備,以及光阻塗佈機、顯影機、晶質清洗和檢測設備。EVG成立於1980 年,藉由一個完備的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務,更多相關資訊講 參考公司網站:www.EVGroup.com。

https://n.yam.com/Article/20221110874589